

## 用中子活化分析法对制造器件用的半导体硅中Na,Cu,Au含量的分析

\$硅材料活化分析组

收稿日期 修回日期 网络版发布日期:

**摘要** 本文介绍了用作器件的半导体硅片表面和本体中Na,Cu,Au含量的堆中子活化分析方法。给出了探测极限。除了常用的“相对比较法”外,着重介绍了“代用标准法”。为了适应常规分析的要求,我们以铁丝作Cu和Na的代用标准,使照后的标准处理摆脱了放射性溶液操作。

关键词

分类号

### 扩展功能

#### 本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(436KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

#### 服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

#### 相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

### Abstract

### Key words

DOI

通讯作者